International application No.
PCT/JP2004/000014

International application No.
PCT/JP2004/000014

		PCT/JE	2004/000014
	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		***
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No
Y	US 2002/0146855 Al (Takenori GOTO), 10 October, 2002 (10.10.02), Par. Nos. [0142] to [0147]; Fig. 20 & JP 2002-305358 A Par. Nos. [0074] to [0079]; Fig. 20 & JP 2002-305349 A	,	3-13
Y .	Kazuhide KUMAKURA et al., 'Low-resistance nonalloyed ohmic contact to p-type GaN us strained InGaN contact layer', Applied Pt Letters, 15 October, 2001 (15.10.01), Vol No.16, pages 2588 to 2590	3-13	
Y	JP 2002-305204 A (Nippon Telegraph And T Corp.), 18 October, 2002 (18.10.02), Par. Nos. [0034] to [0035]; Figs. 5, 7 (Family: none)	elephone	5-7,10-13
			·
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	• • • • •	
	*	•	

International application No.
PCT/JP2004/000014

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
Claims Nos.:  because they relate to parts of the international application that the state of the state
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international search in the search of the sea
feature so linking a group of inventions of claims as to feature so.
inventive concept in order that the group of inventions as to form a single general
1-1
4, 8-13; the invention of claim 5; the invention of claims 3,
of claim 7. (Continued to extra sheet.)
(concinued to extra sneet.)
1. X As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment
of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Remark on Protest
No protest accompanied the payment of additional search fees.
List and payment of additional scalar rees.

International application No.
PCT/JP2004/000014

# Continuation of Box No. II of continuation of first sheet(1)

Document 1: JP 11-150296 A (Toshiba Corp.), 02 June, 1999 (02.06.99)

The technical feature common to claims 1-13 is "formation of a p-type nitride semiconductor layer containing In by regrowth on a p-type nitride semiconductor processed by etching".

However, the international search has revealed that this technical feature, "formation of a p-type nitride semiconductor layer containing In by regrowth on a p-type nitride semiconductor processed by etching", is not novel since it is disclosed in document 1, Figs. 32, 35, 36.

Consequently, the common feature, "formation of a p-type nitride semiconductor layer containing In by regrowth on a p-type nitride semiconductor processed by etching", is not a special technical feature within the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence, since it makes no contribution over the prior art.

Consequently, it appears that claims 1-13 do not satisfy the requirement of unity of invention.

Independent claims 3, 8 involves a special technical feature, "formation of a p-type nitride semiconductor layer containing In by regrowth on a p-type base layer exposed by etching an n-type emitter layer". Therefore, the international application contains five inventions: the invention of claims 1, 2; the invention of claims 3, 4, 8-13; the invention of claim 5; the invention of claim 6; and the invention of claim 7.



## 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 PF15Y13	今後の手続きについては、様式PCT/ISA/220 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/000014	国際出願日 (日.月.年) 06.01.2004	優先日 (日.月.年) 06.01.2003
出願人(氏名又は名称) 日本電信電話株式会社		
国際調査機関が作成したこの国際調査幸 この写しは国際事務局にも送付される。	B告を法施行規則第41条(PCT18条	)の規定に従い出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で5	<b>ページである。</b>	
□ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。		
この国際調査機関に提出	まか、この国際出願がされたものに基づされた国際出願の翻訳文に基づき国際制	質査を行った。
D. L. この国际山旗は、メクレオラ	f ド又はアミノ酸配列を含んでいる(第	1 懶麥照)。
2. □ 請求の範囲の一部の調査ができない(第Ⅱ欄参照)。		
3. 区 発明の単一性が欠如している(第Ⅲ欄参照)。		
4. 発明の名称は 🔀 出願力	、が提出したものを承認する。	
(人) 次に対	ぐすように国際調査機関が作成した。	<i>Y</i> -
<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5. 要約は 🗵 出願/	、が提出したものを承認する。	
国際調		47条(PCT規則38.2(b))の規定により 際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ る。
<ul><li>6. 図面に関して</li><li>a. 要約書とともに公表される図は、</li><li>第1 図とする。 区 出願人が示したとおりである。</li></ul>		
□ 出	願人は図を示さなかったので、国際調査	E機関が選択した。 .
□ 本	図は発明の特徴を一層よく表している <i>0</i>	つで、国際調査機関が選択した。
b 要約とともに公表される図に	tav.	

様式PCT/ISA/210 (第1ページ) (2004年1月)



国建一、報告	国際出願番 РСТ/ЈР2004/000014
第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ペー	ージの2の締ま)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際 成しなかった。	調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
1. 開求の範囲 は、この国際調査機関 つまり、	が調査をすることを要しない対象に係るものである。
2. □ 請求の範囲 は、有意義な国際調査ない国際出願の部分に係るものである。つまり、	をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい
3.	あってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に
第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの)	3 の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(特別ページ)に記載したように、請求の範囲に を満たすには、その一群の発明を単一の一般的発明 の、特別な技術的特徴の存在が必要であるところ、 際出願の請求の範囲には、[1, 2]、[3, 4, 8 5個の発明が記載されている。	明概念を形成するように連関させるため この国際出願の請求の範囲には、この国
1. × 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したの範囲について作成した。	<b>とので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求</b>
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能が調査手数料の納付を求めなかった。	<b>おな請求の範囲について調査することができたので、追</b>
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に紹 付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。	枘付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
	*
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかった されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。	とので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意  □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがる	あった。

※ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

#### A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC))

Int. Cl7 H01L29/737, H01L21/331, H01L21/28

#### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> H01L29/73-29/737, H01L21/331, H01L21/28

#### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国実用新案登録公報日本国登録実用新案公報

1996-2004年1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語).

# C. 関連すると認められる文献 引用文献のカテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 関連する請求の範囲の番号 X JP 11-150296 A (株式会社東芝) 1,2 1999.06.02,第32,35-36図(ファミリーなし) 1,2 Y L. S. McCarthy et. al., 'AlGaN/GaN Heterojunction Bipolar Transister', IEEE Electron Device Letters, JUNE 1999, Vol. 20, No. 6, p. 277-279 3-13

L	第1図 (ファミリーなし)	
X	C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

1998.03.06,段落番号【0008】-【0009】,

JP 10-65216 A (豊田合成株式会社)

#### \* 引用文献のカテゴリー

Y

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

#### の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの

 $3 - 1 \ 3$ 

- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 01.04.2004	国際調査報告の発送日 13.4.	2004
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 渕 真悟	4 L 2 9 3 3
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	为線 3496

	(A)	国际山願街(して)」「P20)	74/000014
<b>C(続き)</b> .	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	US 2002/0146855 A1 to) 2002. 10. 10, 段落番号 [0142] — [0147], I & JP 2002-305358 A, 【0079】, 第20図 & JP 2002-305349 A	(Takenori Go FIG. 20	3-13
Y	Kazuhide Kumakura et. al., 'Low-resis contact to p-type GaN using strained Applied Physics Letters, 15 October 2 p. 2588-2590	InGaN contact layer',	3-13
Y	JP 2002-305204 A (日本 2002.10.18, 段落番号【003 第5,7図 (ファミリーなし)		5-7, $10-13$
	· ·		
·	· ·		
,			
·			
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		·	
			·

.

文献1: JP11-150296 A (株式会社東芝), 1999.06.02

請求の範囲1-13に共通な事項は「エッチング加工を施したp型窒化物半導体上に、再成長させたInを含むp型窒化物半導体層を設けた」構成である。

しかしながら、調査の結果、この「エッチング加工を施したp型窒化物半導体上に、再成長させたInを含むp型窒化物半導体層を設けた」構成は、文献1の第32図、第35-36図に記載されているから、新規でないことが明らかとなった。

結果として、「エッチング加工を施したp型窒化物半導体上に、再成長させたInを含むp型窒化物半導体層を設けた」構成は先行技術の域を出ないから、PCT規則13.2の第2文の意味において、この共通事項は特別な技術的特徴ではない。

よって、請求の範囲1-13は単一性の要件を満たしていないことが明らかである。

そして、独立請求の範囲 3、8において、特別な技術的特徴として、「n型エミッタ層をエッチングすることにより露出されたp型ベース層の表面に、再成長させた I n を含む p型 窒化物半導体層を設けた」構成を有することから、この国際出願の請求の範囲には、[1,2]、[3,4,8-13]、[5]、[6]、[7]に区分される 5 個の発明が記載されていると認める。